

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成19年11月15日(2007.11.15)

【公開番号】特開2005-291874(P2005-291874A)

【公開日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【年通号数】公開・登録公報2005-041

【出願番号】特願2004-106462(P2004-106462)

【国際特許分類】

G 0 1 N 21/956 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/956 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年9月27日(2007.9.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 3】

この第2の実施の形態のムラ欠陥検査装置20は、照明装置12をフォトマスク50の下方に配置したものである。従って、受光器13は、照明装置12から照射され、フォトマスク50のチップ55における繰り返しパターン51間を透過する透過光、特にこの透過光のうち、単位パターン55のエッジ部で回折された回折光を受光し、受光データに変換する。